フラーレン生成過程の分子動力学 (第2報,完全な C₆₀へのアニーリング)

丸山 茂夫^{*1}, 山口 康隆^{*2}

A Molecular Dynamics of the Formation Process of Fullerene (2nd Report, Annealing to the Perfect C₆₀ Structure)

Shigeo MARUYAMA and Yasutaka YAMAGUCHI

The formation of a fullerene was simulated using the molecular dynamics method. The clustering process starting from 500 isolated carbon atoms was simulated under nearly equilibrium conditions at $T_c = 3000$ K with a density of 30 times lower than that in our previous study for investigation of the effect of annealing during collisions. The small clusters appeared in this simulation were simpler than those in the previous case; they were grown with a simple chain or ring structure for $C_{n<20}$, a 3-dimensional chaotic structure for around $C_{20<n<40}$, and a fullerene-like caged structure for $C_{n>40}$. Since the density of carbon atoms in the simulation was still high due to the computational limitation, these clusters are expected to have a much longer collision-free time in practice. For further evaluation of the effect of annealing, a C_{60} structure obtained from the simulation was annealed without collision at $T_c = 2500$ K. Through successive organized network transformations known as Stone-Wales rearrangement, a perfect fullerene-structured C_{60} was finally formed in about 50 ns. From the viewpoint of the Arrehenius type reaction rate of rearrangement, the high temperature of 2500 K and the time-scale of 50 ns for annealing were comparable to experimental conditions.

Key Words: Molecular Dynamics Method, Fullerene, Annealing, Stone-Wales Rearrangement, Arrhenius Plot

1. はじめに

1985年にKrotoら⁽¹⁾によって発見されたフラーレン は,後の大量生成法^(2,3)と単離法⁽⁴⁾の確立によって炭素 の第三の同素体構造と認知された.その後,金属をド ープしたK₃C₆₀の超伝導特性(臨界温度18K)の発見⁽⁵⁾ や,ケージ構造内部に金属を含む金属内包フラーレン ⁽⁶⁻⁹⁾の量的生成などの話題が次々に現れている.現在も 広く物理・化学の分野で化学反応特性の解明と超伝導 特性や半導体特性に着目した応用のための研究が国内 外で盛んに行われている.また最近では微量のC₆₀を トルエンに溶解すると壁面摩擦が極めて小さくなるこ と⁽¹⁰⁾や,炭素ナノチューブのきわめて高い引張強度⁽¹¹⁾ など,工学的応用の可能性を示唆する報告も増えてい る.実験的には,黒鉛棒間のアーク放電やレーザー照 射によって,フラーレンが多量に生成されることが知 られているが^(2,3,12),炭素原子がC₆₀やC₇₀等の極めて対称性の高い構造を自己形成するメカニズムは依然として明らかとなっていない.C₆₀より大きなフラーレンやグラファイトの方がエネルギー的には安定であるにも関わらず,実用的なフラーレン生成装置ではC₆₀が特に選択的に生成され,フラーレン全体の80%程度までを占めること,抽出される高次フラーレンのマジック数,あるいは金属内包フラーレンの構造選択性などは,中間生成物の構造といったフラーレン生成の動的な機構を考えなければ説明できないものであろう.

Haufler ら⁽³⁾は C₂ や C₃ が次々に結合してネットワー ク構造を形成する段階で, すべてが六員環であれば完 全に平面状の構造となりグラファイトが生成されるが, 途中で構造欠陥として五員環ができると一定の曲率を もつようになり,ちょうど 12 個の五員環が導入された

原稿受付

^{*1} 正員,東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻(〒113 東京都文京区本郷 7-3-1)

ときに完全に閉じたフラーレンとなると説明している. ここで,エネルギー的に不利な五員環の導入を促す機 構が,中間生成物のダングリングボンドの総数が五員 環を導入した三次元構造の方が少なくなることである と考え,水素原子などのようにダングリングボンドを 終端させる原子が存在すると,この機構が働かずにグ ラファイトが選択されるとしている.少量の水分子の 存在によりフラーレンの収率が極端に減少することか ら⁽³⁾,水素原子の存在が天然のフラーレンの存在を阻 んでいたとしている.また,五員環が二つ並ぶような ネットワーク構造は局所的に極めて不利なエネルギー 状態となるため存在できないという Isolated Pentagon Rule (IPR)が提案された.このルールによると最小の閉 殻構造は C₆₀, 二番目は C₇₀ ということになるが, より 大きなサイズでは多数の異性体が考えられる.一般に マクロ量で生成されるフラーレンが IPR を満たすとい う仮定は高次フラーレンの幾何学的構造を決める上で の拠りどころとなっている.

全く異なった考え方として,フラーレンを生成する ときの材料として用いている黒鉛の平面的なネットワ ーク構造の破片が変形し,丸まってフラーレンとなる とするモデル⁽¹³⁾や,一旦ナノチューブができた後で分 裂してフラーレンとなるなどのモデル⁽¹⁴⁾が提案され, 分子動力学法によってこのような変形の過程が計算さ れている⁽¹³⁾.しかし¹²Cと¹³Cの同位体を用いた生成実 験によって⁽¹⁵⁻¹⁷⁾,一旦は炭素原子あるいはC₂やC₃とい ったレベルまで分解した後にフラーレンが生成されて いることが証明され,黒鉛材料のネットワークがその まま丸まってフラーレンとなる可能性が否定された. ただし,分解した炭素原子が再度平面構造を形成して からこれらのプロセスを辿るという可能性までは否定 できない.また興味深いことにナフタレンを用いた燃 焼合成においては, 元々のナフタレン構造の影響を色 濃く残すと考えられるフラーレンのマジック数が選択 されることが報告されており⁽¹⁸⁾,必ずしも炭素が原子 状態まで分解することがフラーレン合成の必須条件と は考えにくい.

Heath⁽¹⁹⁾は原子レベルまで分解した状態から始まり, C₁₀程度の直鎖型のクラスターに成長し,更にC₁₀から C₂₀程度の環状のクラスターを経てC₃₀程度の大きさの ケージ構造となり,ちょうどレーザー励起によるC₂解 離⁽²⁰⁾の逆の反応によってC₂が加わり,より大きなフラ ーレンに成長していくとのモデルを提案している.こ れによるとC₂の追加は五員環が隣接するところで起 こりやすく,ちょうどC₆₀になりIPRを満たすまで急 速に反応が進むとしている.レーザー蒸発超音速膨張 法による質量スペクトルの特徴を素直に表現したモデ ルであるとともに,アーク放電法などの生成によって C₆₀が特に選択的に生成される事実を説明しうること が特徴である.

若林ら⁽²¹⁾は適当な大きさの環状クラスターが積み重 なってフラーレンが形成されると考えるリングスタッ キングモデルを提案し,中間体の履歴について詳細に 検討した.IPR の条件と中間生成物のエネルギー的な 安定性も含めて考えると,高次フラーレンのマジック 数^(22,23)やC₇₆,C₈₂,C₈₄の異性体⁽²⁴⁾の幾何学構造を説明 できるとする非常に強力なモデルである.

一方 2-5 Torr のヘリウムを充填し弱い電場を掛けた ドリフトチューブに質量選別されたクラスターイオン を照射するというイオンクロマトグラフィーによって、 C_{60} ⁺の異性体である環状や二重環 ,三重環のクラスター が高温で変形してフラーレン構造となることが示唆さ れ^(25,26), これらの構造がフラーレンの前駆体となると のモデルが提案されている.また,ランタンを内包す るフラーレン La@C₆₀ も同様な二重環構造 La(C₆₀)が変 形して生成するとの解釈がなされている(27)[ケージ構 造内部の原子 A と外の原子 B を明示的に区別するため に(A@C₆₀)Bのような記号を用いる⁽⁶⁾].実験的な結果 に基づく非常に有力なモデルであるが,ここで供され るクラスターはレーザー蒸発超音速膨張冷却法による ものであり,必ずしもアーク放電等の生成方法で同一 の異性体クラスターが存在するとは結論できない.実 際にシリコンクラスターについて似通ったレーザー蒸 発クラスター源からでさえ別の異性体が選択的に生成 され議論となったこともあり⁽²⁸⁾,注意が必要である.

また,Lagowら⁽²⁹⁾は,端部を C≡N などによって終結 したアセチレン状の直線構造が安定であることを示唆 し,レーザー蒸発法により得られるクラスターのスペ クトルはこのような直線構造のクラスターのものであ り,これらが低温で凝縮する際に螺旋状に丸まってフ ラーレンが形成されるとしている.しかし,これら二 つのモデルではいずれも原子数 60 個の長さの環状,鎖 状構造が選択的に生成されないと C₆₀ の特異性を説明 できない.

フラーレン生成に関する分子シミュレーションもい くつか行われている. Chelikowsky⁽³⁰⁾は分子動力学法 により 60 個の炭素原子の冷却過程を計算し,高温状態 からの急冷によりケージ構造の形成を計算している. しかし,炭素原子密度が極めて高いため(本報の約3000 倍のオーダ), クラスターの構造選択の自由度がほと んどなく,初期条件に強く依存して構造が決まっている.

また前述のようにグラファイトのネットワークの破 片を初期条件として用いた分子動力学計算⁽¹³⁾もあるが, 高温条件下で平面構造が曲率をもつ可能性を示したに 過ぎない.

さらに,60個の炭素原子からなる三重環構造を初期 条件として用いたもの⁽³¹⁾や,Tight-Bonding 法を用い, 球面的な境界条件を課してケージ構造シミュレートし たもの⁽³²⁾などが報告されているが,いずれも,意図的 にケージ構造をとるべく人工的に加えた条件に強く依 存しており,炭素原子が自発的にフラーレン構造を選 択するメカニズムを説明するには不十分である.また 完全なフラーレン構造に至った計算は,著者らの知る 限りでは存在しない.

著者らは比較的長時間に渡る冷却過程を計算可能な 分子動力学法によって,フラーレン生成機構の解明に 向けたシミュレーションの可能性を追ってきた^(33,34). 前報⁽³⁴⁾では,速やかに運動エネルギーが平衡状態に向 かう温度制御法を用い,制御温度*T_c* < 2500 K の低温環 境下ではグラファイト的平面構造を,2500 K < *T_c* <3500 K 程度では,フラーレン的ケージ構造,更に*T_c* > 3500 K の高温環境下では,三次元的なランダム構造をとると いう結果が得られた.またフラーレン的構造となる条 件では,C₄₀程度以下の前駆体は,常に高い振動温度を 持ちながらネットワーク構造を変化させており,安定 構造を形成しないまま C₄₀ 程度に成長し,そこでのア ニールによりケージ構造の基礎を形成することが分か った.

しかし,この計算では時間圧縮のため炭素原子密度 を高くし,その補償として急冷と並進,回転,振動温 度の強い平衡条件を課しているが,衝突から次の衝突 までの間に,十分なアニールの時間を与えられないと いう問題が残った.最終的に得られたクラスターが, 実験的に多く得られる C₆₀, C₇₀ と比べて比べ遥かに大 きなサイズのもの(C₁₅₀ 程度)であったこともこれが 原因と考えられる.

そこで本報では比較的低密度の条件下で,クラスタ ー成長の様子を観察した.更に,ケージ状のクラスタ ーが C₆₀ 程度の大きさで衝突無くアニールする可能性 について詳細に吟味した.また,温度と時間スケール について,実験的なフラーレン生成条件との相関を考 慮し,現実的な温度とアニール時間でケージ状のクラ スターが完全なフラーレン構造を形成しうるかについ て検討した.

記号

B^{*}	:	結合価関数
D	:	ポテンシャル深さ
E_b	:	結合エネルギー
f	:	カットオフ関数
k_B	:	ボルツマン定数
N_{DB}	:	ダングリングボンドの総数
R_e	:	平衡原子間距離
r_{ij}	:	原子 <i>i</i> と原子 <i>j</i> 間の距離
S	:	ポテンシャルパラメータ
Т	:	温度
T_c	:	制御温度
t	:	時間
V_A	:	引力項
V_R	:	斥力項

ギリシャ文字

b	:	ポテンシャルパラメータ
d	:	ポテンシャルパラメータ
q	:	結合間角度

2. 計算方法

炭素原子間ポテンシャル,及び,用いたパラメータ は既報⁽³⁴⁾と同様で,Brenner⁽³⁵⁾がダイヤモンド薄膜の CVD のシミュレーションに用いたポテンシャルを簡 略化して用いた.系全体のポテンシャル*E*_bは各原子間 の結合エネルギーの総和により次のように表される.

$$E_b = \sum_{i} \sum_{j(i>j)} \left[V_R(r_{ij}) - B^*_{ij} V_A(r_{ij}) \right]$$

ここで以下に表される V_R(r), V_A(r)はそれぞれカットオ フ関数 f(r)を含む Morse 型の反発力項,引力項である.

$$V_{R}(r) = f(r) \frac{D_{e}}{S-1} \exp\left\{-b\sqrt{2S}(r-R_{e})\right\} \dots (2)$$

$$V_{A}(r) = f(r) \frac{D_{e}S}{S-1} \exp\left\{-b\sqrt{2/S}(r-R_{e})\right\} \dots (3)$$

$$f(r) = \begin{cases} 1 & (r < R_{1}) \\ \frac{1}{2}\left(1 + \cos\frac{r-R_{1}}{R_{2} - R_{1}}p\right) & (R_{1} < r < R_{2}) \dots (4) \\ 0 & (r > R_{2}) \end{cases}$$

*B**は結合 *i*-*j* と隣り合う結合 *i*-*k* との角度_{Qjk}の関数で,
 結合状態を表すように引力項の係数となっている.



Fig. 1 Growing process of a C₇₀ cluster

$$B^{*}_{ij} = \frac{B_{ij} + B_{ji}}{2} , B_{ij} = \left(1 + \sum_{k(\neq i,j)} [G_{c}(\mathbf{q}_{ijk})f(r_{ik})]\right)^{-d} \cdots (5)$$
$$G_{c}(\mathbf{q}) = a_{0} \left(1 + \frac{c_{0}^{2}}{d_{0}^{2}} - \frac{c_{0}^{2}}{d_{0}^{2} + (1 + \cos q)^{2}}\right)$$

温度制御に関しても前報⁽³⁴⁾と同様であり,時間圧縮 を反映して強く平衡状態に向かう制御とするため,系 内のクラスターの運動を並進,回転,振動の運動エネ ルギーに分離し,それぞれの平均温度に対して,0.1 ps 毎に制御温度との差を 60 %に縮小するよう独立に速 度スケーリングを施した.また,運動方程式の数値積 分には Verlet 法を用い,時間刻みを 0.5 fs とした.

3. 分子動力学シミュレーション

3.1 前駆体の反応過程 前駆体の構造に注目し, クラスタリング過程を詳細に検討した.全方向に周期 境界条件を科した一辺 342 Å の立方体のセルに,500 個の炭素原子をランダムに配置し,制御温度 T_c = 3000 K で計算を行った.これは温度については,前報⁽³⁴⁾の シミュレーションからケージ構造が形成されると考え られる条件であるが,密度に関しては約 1/30 程度の条 件となっている.計算により得られた代表的クラスタ ーの成長過程を図1に示す.シミュレーション開始か ら 2500 ps 後に実現されたケージ状の C₇₀ クラスターに ついて,時間をさかのぼって,どの時点でどのような 構造のクラスター同士が合体して出来たのかという成

長履歴の概略を表現した.例えば,約 1900 ps から約 2000 psの間では独立して存在していた C₆₀ と C₈ が,約 2000 ps の時点で合体して C68 となり, その後, 約 2100 psの時点で C 原子が加わり C69 となり,約 2130 ps に更 にもう一つの C 原子が加わって C70 となったという過 程が示されている.ただし,C。より小さなクラスター の前歴については図から省略している.成長過程初期 の C₂₀ 以下の前駆体は,基本的に鎖状構造,あるいは リングで構成される極めて単純な構造をとっている. これは前報⁽³⁴⁾の高密度系で得られている同程度の大き さのクラスターと比較すると,アニールの時間が長い ため,より単純な構造をとっており,これらが C₂₀ 程 度に成長する段階で三次元的に不規則な構造をもつク ラスターに変化している.そして不安定な状態で構造 を無秩序に変化させながら C40 以上に成長し, その後, C₅₀程度の大きさでケージ構造に移行し始める,この大 きさで,アニールにより完全なケージ構造を模索する が, 歪みの小さいケージ構造を形成するには炭素原子 数が足りないため大きな孔が残っている.更に C₆₀程 度に成長すると空孔の無いケージ構造を形成し,より フラーレンに近い構造をとっていることが分かる.

また各クラスターの非衝突時間についてみると, C₆₀, C₇₀の状態が極めて長くなっているが,これは前報⁽³⁴⁾ で解析したように衝突断面積の影響であると考えられ る.C₆₀, C₇₀の程度のクラスターの衝突断面積はケー ジ構造にアニールするとリング構造の C₁₅ と同程度と なる.ところが並進速度は質量の平方根に反比例して 遅くなるため,結果的に他のクラスターとの衝突確率 が大きく減少することになり,より長時間に渡って衝



(a) 3-dimensional structure (b) Schlegel diagram

Fig. 2 Initial structure of the C_{60} cluster

突なくアニールすることが可能となると推察される.

3.2 完全なフラーレン構造へのアニール 前節に 示した計算条件は前報⁽³⁴⁾と比較して低密度であるとは いえ,依然として実際のフラーレン生成環境と比較す ると遥かに炭素原子密度が高い状態となっている.こ のため,他のクラスターとの衝突確率の低い C₆₀, C₇₀ の程度のケージ状のクラスターに関しても、十分なア ニール時間を与えられているとはいい難い.そこで, 仮想的に十分なアニール時間を与えるため,ケージ状 構造の C₆₀ クラスターに着目し,長時間に渡って衝突 させずに高温状態に保持した.図2に初期条件として 採用したケージ状構造の C₆₀の三次元形状[図 2(a)],及 び図 2(a)の太線で示した五員環の中心を軸に極座標変 換し,平面表示したもの[図 2(b)]を示す.ここで,図 2(b)では最外周以外の五員環にハッチングを施し、ダン グリングボンドを持つ炭素原子を白抜きにしてある. このクラスターは 60 個の孤立炭素原子のクラスタリ ングによって得られたものであるが(36),ケージ構造を とってはいるものの,図1の1900 ps 程度に実現された C60とほぼ同等で,ダングリングボンドを持つ炭素原子, 七員環,八員環,隣接する五員環群などを含み,完全 なフラーレン構造とはかけ離れたものである.初期の8 nsの間 T_c = 3000 K に制御し, その後, T_c = 2500 K に温 度を下げて計算を行った.

図3に8ns以降の炭素原子一個あたりの平均ポテン シャルエネルギー,ダングリングボンドの総数,及び 35ns以降のネットワーク構造の変化を示す.但し,約 0.05ns以下の間に瞬間的に現れるダングリングボンド は除いてある.8ns後には全ての原子が3つの結合手 をもつ状態にあり,それ以降はしばらくダングリング ボンドをつくることなく,系統的にネットワーク構造 を変化していく.その後,16ns程度で歪みの蓄積によ り再びダングリングボンドを発生し,ポテンシャルエ



Fig. 3 Annealing process to the perfect C_{60}



(b) Generalized Stone-Wales rearrangement

Fig. 4 Stone-Wales type network transformation

ネルギーの高い不安定状態に陥るが,19 ns で再びダン グリングボンドを解消する.約 28 ns で同様にダングリ ングボンドを発生するが35 ns 程度で解消し,その後, 図3上のネットワークに示すように五員環,六員環を 移動し,最終的に52 ns で切頭二十面体構造の完全フラ ーレン構造 C₆₀に至った.

ここでのダングリングボンドを発生しない過程では, 構造を系統的に変化させているが,これについて詳し く観察すると,ほぼすべての過程で図4に示されるよ うな Stone-Wales (SW)変換⁽³⁷⁾,及び Generalized Stone-Wales (GSW)変換により行われている.ここで図4(a) に示される SW 変換では白ヌキの原子間の結合を90度 回転させることで五員環,六員環の配置が変化してい るが,この過程で各二つの五員環,六員環を構成する 炭素原子外部の結合状況は全く変化しておらず,また, 消滅する結合,新規結合ともに最小の2つで構造を変 化させている.また,これ以外の配置でも,図4(b)に 示すようにSW変換と同様の経路を辿るGSW変換によ リネットワーク構造が変化している.これらのStone-Wales 変換が量子化学的に許容されるか否かについて は議論があるが,最近,比較的小さな活性化エネルギ ーで可能であるとの報告⁽³⁸⁾がされている.本研究の古 典分子動力学法では,この変換が問題なく実現されて いる.

3.3 温度,時間スケールに関する考察 前節で長時間のアニールによりフラーレン構造の形成が可能であるということがシミュレートされたが,ここで用いた2500 Kという高温と約 50 ns というアニール時間が現実的かということが問題となる.ここで注意するべき点は,フラーレン生成環境での温度は,レーザー蒸発法では1000~2000 K,アーク放電法では約 1000 K 程度であると想像され,また1000 K程度以上の高温で長時間維持するとC₆₀が解離してしまういわれている. 本シミュレーションでは時間の仮想的圧縮と関連してアニーリング効率を上げるため,温度をかなり高く設定していると考えている.そこでこれらの時間スケールと温度の関係を評価するため C₆₀ の反応速度について考察を加えた.

初期条件として炭素原子 60 個を切頭二十面体構造 の C₆₀の安定位置に配置し,1 ns に渡って 2200 K~3000 K の範囲の所定の温度に制御し,その間のクラスター 内での炭素原子間結合が生成,消滅する頻度(bond switching),及び五員環の移動の頻度(pentagon migration) をアレニウス型のグラフにプロットした[図 5].結合変 化,五員環移動ともに直線関係が成り立ち,その傾き から,結合の生成,消滅に関して約 1.9 eV,五員環の 移動に関して約 2.5 eV の活性化エネルギーが見積もら れるが,これらはポテンシャルの変化を観察して見積 もった活性化エネルギーとほぼ一致する.

図 5 の結果を大きく外挿して考えると,五員環の移動に関して 2500 K で 50 ns 程度のオーダーの現象は, レーザー蒸発法でのアニール温度を約 1500 K と仮定 すると 100 µs 程度,アーク放電法でのアニール温度を 約 1000 K とすれば 10 ms 程度に対応することになる. これらの時間スケールは共に,それぞれの方法で実験 的結果からフラーレン生成に要すると考えられる時間



Fig. 5 Arrehenius plot of the reaction rate of C₆₀ fullerene

スケール^(12,39)と矛盾しないと考えられる.すなわち, C₆₀程度のクラスターが現実の系で存在するとすれば, その温度,時間スケールでのアニールによりフラーレ ン構造を形成しうるということになる.このような外 挿の考え方は一般的には極めて危険であり,一定の温 度以上で可能となる反応などがあると,全く異なる結 論となることも考えられる.

4. フラーレン形成モデル

不完全な C₆₀構造を一定のアニーリングによって完 全なフラーレン構造に変換することができたが,実際 にはクラスタリング途中のすべての前駆体に対して相 応のアニーリングが期待される.この点に注意して本 シミュレーションの結果から予想されるフラーレン生 成機構モデルは以下の通りである.

アーク放電法やレーザー蒸発法の場合は,一旦原子 状態となり,これらが成長して C₈程度までは鎖状の場 合が多く,これ以上大きくなると C₁₅ 程度まではリン グ状の構造を持つ場合が多い.これらの前駆体同士の 合体によってできる C₂₀~C₄₀ 程度の大きさのクラスタ ーは非常に複雑で不安定な構造となり,Bowers らのモ デルのように非常に高温で激しい反応の後にケージに 近い構造となる.しかしながら,この時点では炭素原 子数が少なすぎて,十分なアニールによっても完全な ケージ構造とはなれない.この状態は十分にダングリ ングボンドがあるために,更に小さなクラスターが加 わり,アニーリングをしながら最安定な状態を模索し, ちょうど C₆₀ となると IPR を満たす完全なケージ構造 をもちうると考えられる .この部分のシナリオは Heath のモデルに近いが,完全に閉じていないで付加反応が 続くという点は異なる.また,付加されるクラスター の大きさによってちょうど C₆₀ とならない場合は更に 反応が進み,C₇₀ が次に可能なサイズとなる.ここで C₆₀ や C₇₀のように IPR を満たしてアニールしている場 合には他のクラスターの衝突によってもそれ以上は反 応しないと考えられる .C₇₀ 以上では炭素数が偶数個で あればほとんどのサイズで IPR を満たす構造が多数存 在し,エネルギー差も小さい.よって偶然そのサイズ になる確率と,そのサイズでのアニーリング速度など が関係して,適当な形状を持ったところで反応がほと んど終わると考えられる.

ここで改めて第1章の各種フラーレン生成機構モデ ルと比較してみる.シミュレーションでは,C₂₀~C₄₀ 程度の範囲でエネルギー的に不安定な半球殻状の構造 が安定に存在することはなく,これらの存在を基本と する Haufler⁽³⁾, 若林ら⁽²¹⁾のモデルとは大きく食い違う 結果となっている.また,グラファイト的な構造が形 成される温度条件では,その後も基本的に平面的に成 長するため⁽³⁴⁾ , これらが丸まってフラーレンを形成す る確率は低いものと考えられる.前駆体の構造として は Heath⁽¹⁹⁾のモデルに近いが,完全なフラーレン構造は 最終的にアニールによる構造変換によって得られると いう点が大きな違いである.さらにここで重要な点は, 逆に初期条件として C₆₀ 程度の大きさの環状, 鎖状構 造が鎖状が存在する場合に, それらをアニールするこ とによってもフラーレンの生成が可能であるというこ とになり,これらを前駆体とする Helden⁽²⁵⁾らの実験結 果とも矛盾しない.またナフタレンなどを原料として 生成する実験に対する解釈も十分に可能であると考え られる.

5. 結 論

分子動力学法を用い,高温環境下でランダムに分布 する孤立炭素原子のクラスタリングにより C₆₀,C₇₀ な どのケージ状クラスターの生成過程をシミュレートし た.現実の温度,時間スケールと対比して妥当なアニ ールにより C₆₀の不完全フラーレン構造が,切頭二十 面体のフラーレン構造を自己形成することが計算され た.ここで用いたポテンシャルは共鳴などの効果を含 んでおらず,歪みによる効果のみでフラーレン構造を 形成することが可能であることは注目すべき点である. これらのシミュレーションによる結果を踏まえ,フ ラーレン生成機構のモデルを提案し,既存のモデルと の比較検討を行った.

謝 辞

筆者の一人(丸山)の長期海外出張のホストであった Rice 大学の Smalley 教授に感謝し,ここにそのノーベル化学賞授賞をシミュレーションで得られた完全な C60 構造で祝福する.また,本研究の遂行に当たり, 文部省科学研究費基盤研究 07555068,及び特別研究員 奨励費 08004746 の補助を受けた.

文 献

- Kroto, H. W., ほか4名, Nature, 318-6042 (1985), 162-163.
- (2) Krätschmer, W. ほか3名, Nature, 347 (1990), 354-358.
- (3) Haufler, R. E., ほか7名, Mat. Res. Soc. Symp. Proc.,
 206 (1991), 627-638.
- (4) Taylor, R., ほか3名, J. Chem. Soc. Chem.*Communications*, **1423** (1990), 1423-1425.
- (5) Hebard, A. F., ほか7名, Nature, 350 (1991), 600-601.
- (6) Chai, Y., ほか 8 名, J. Phys. Chem., 95 (1991), 7564-7568.
- (7) Shinohara, H., ほか2名, J. Phys. Chem., 96 (1992), 3571-3573.
- (8) Kikuchi, K., ほか 8 名, Chem. Phys. Lett., 216-1,2 (1993), 23-26.
- (9) Takata, M., ほか6名, Nature, 377 (1996), 46-48.
- (10) Campbell, S. E., ほか4名, Nature, 382 (1996), 520 522.
- (11) Treacy, M. M., ほか2名, Nature, 381 (1996), 678-680.
- (12) 丸山・ほか3名,第31回日本伝熱シンポジウム講 演論文集 (1994),943-945.
- (13) Robertson, D. H., ほか 2 名, J. Phys. Chem., 96 (1992), 6133-6135.
- (14) Dravid, V. P., ほか6名, Science, 259 (1993), 1601 1604.
- (15) Meijer, G. & Bethune, D. S., J. Chem. Phys., 93 (1990), 7800-7802.
- (16) Hawkins, J. M., ほか3名, J. Am. Chem. Soc., 113

(1991), 9394-9395.

- (17) Ebbesen, T. W., ほか2名, Chem. Phys. Lett., 191(1992), 336-337
- (18) Taylor, R., ほか3名, Nature, 366 (1993), 728-731.
- (19) Heath, J. R., *Fullerenes*, Ed. G. S. Hammand & V. J. Kuck, American Chemical Society (Washington, D. C.), (1992), 1-23.
- (20) O'Brien, S. C., ほか3名, J. Chem. Phys., 88 (1988)
 220-230.
- (21) Wakabayashi, T. & Achiba, Y. Chem. Phys. Lett., 190 (1992), 465-468.
- (22) Kikuchi, K., ほか 11 名, Chem. Phys. Lett., 188 (1992), 177-180.
- (23) Achiba. Y. & Wakbayashi, T., Z. Phys. D, 26 (1993), 69-73.
- (24) Wakabayashi, T., ほか3名, Chem. Phys. Lett., 201
 (1993), 470-474.
- (25) Helden, G., ほか2名, Nature, 363 (1993), 60-63.
- (26) Hunter, J., ほか2名, Science, 260 (1993), 784-786.
- (27) Clemmer, D. E.,, ほか3名, Nature, 367 (1993), 718-720.
- (28) Maruyama, S., ほか2名, J. Chem. Phys., 93 (1990),
 5349-5351.
- (29) Lagow, R. J., ほか10名, Science, 267 (1995), 362-367.
- (30) Chelikowsky, J. R., *Phys. Rev. B.*, **45** (1992), 12062-12070.
- (31) Schweigert, V. A. ほか3名, Chem. Phys. Lett., 235 (1995), 221-229.
- (32) Astakhova, T. Y., ほか2名, Fullerene Sci. & Tech.,
 4-3 (1996), 347-356.
- (33) Maruyama, S. & Yamaguchi, Y., *Therm. Sci. & Engng.*, **3**-3 (1995), 105-109.
- (34) 山口・丸山, 機論, **63**-611, B (1997), 2398-2404.
- (35) Brenner, D. W., Phys. Rev. B, 42-15 (1990), 9458-9471.
- (36) 丸山・ほか3名,第31回日本伝熱シンポジウム講 演論文集 (1994),946-948.
- (37) Stone, A. J. & Wales, D., Chem. Phys. Lett., 128 (1986), 501-503.
- (38) 大澤・本多, 第 11 回フラーレン総合シンポジウム 講演要旨集 (1996), 155-160.
- (39) Maruyama, S., ほか2名, Rev. Sci. Instrum., 61-12 (1990), 3686-3693.